

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 10 月 5 日 (2006.10.5)

【公開番号】特開 2006-100432 (P2006-100432A)

【公開日】平成 18 年 4 月 13 日 (2006.4.13)

【年通号数】公開・登録公報 2006-015

【出願番号】特願 2004-282687 (P2004-282687)

【国際特許分類】

H 0 1 F 1/08 (2006.01)

B 2 2 F 1/00 (2006.01)

B 2 2 F 3/00 (2006.01)

B 2 2 F 3/02 (2006.01)

H 0 1 F 1/053 (2006.01)

C 2 2 C 19/07 (2006.01)

C 2 2 C 38/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 F 1/08 B

B 2 2 F 1/00 B

B 2 2 F 3/00 F

B 2 2 F 3/02 R

H 0 1 F 1/04 H

C 2 2 C 19/07 E

C 2 2 C 38/00 3 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 8 月 18 日 (2006.8.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 3】

原料合金は粉碎工程に供される。混合法による場合には、低 R 合金及び高 R 合金は別々に又は一緒に粉碎される。粉碎工程には、粗粉碎工程と微粉碎工程とがある。まず、原料合金を、粒径数百 μm 程度になるまで粗粉碎する。粗粉碎は、スタンプミル、ジョークラッシャー、ブラウンミル等を用い、不活性ガス雰囲気中にて行なうことが望ましい。粗粉碎に先立って、原料合金に水素を吸蔵させた後に放出させることにより粉碎を行なうことが効果的である。水素放出処理は、希土類焼結磁石として不純物となる水素を減少させることを目的として行われる。水素放出のための加熱保持の温度は、200 以上、望ましくは 350 以上とする。保持時間は、保持温度との関係、原料合金の厚さ等によって変わるが、少なくとも 30 分以上、望ましくは 1 時間以上とする。水素放出処理は、真空中又は Ar ガスフローにて行う。なお、水素吸蔵処理、水素放出処理は必須の処理ではない。この水素粉碎を粗粉碎と位置付けて、機械的な粗粉碎を省略することもできる。